リ　インプリントリソグラフィテンプレートであって、第一号から第八号の四までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの

ヌ　試験装置であって、半導体素子若しくは集積回路又はこれらの半製品用のもののうち、次のいずれかに該当するもの

（一）　第二号ニに該当する貨物のエスパラメータを試験することができるように設計したもの

（二）　［略］

（三）　第二号ハに該当する貨物の試験を行うことができるように設計したもの

十七の二　マスクの製造に用いられる基材であって、モリブデン及びシリコンからなる多層膜の反射構造を有するマスクブランクのうち、次の（一）及び（二）に該当するもの

（一）　極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したもの

（二）　国際半導体製造装置材料協会が定めたＳＥＭＩ規格Ｐ三七の仕様に準拠したもの

十八　基板であって、当該基板の上に次のいずれかに該当する物質の多層膜の結晶を有し、かつ、当該結晶がエピタキシャル成長されているもののうち、ヘテロエピタキシャル材料となるもの（ニに該当する化合物（窒化ガリウム、窒化インジウムガリウム、窒化アルミニウムガリウム、窒化インジウムアルミニウム、窒化インジウムアルミニウムガリウム、リン化ガリウム、砒化ガリウム、砒化アルミニウムガリウム、リン化インジウム、リン化インジウムガリウム、リン化アルミニウムインジウム又はリン化インジウムガリウムアルミニウムに限る。）のＰ型エピタキシャル層を一層以上有するものであって、当該Ｐ型エピタキシャル層がＮ型層に挟まれていないものを除く。）

イ～ニ　［略］

十九　レジストであって、次のいずれかに該当するもの又はそれを塗布した基板

イ　半導体用のリソグラフィに使用するレジストであって、次のいずれかに該当するもの

（一）　一五ナノメートル以上一九三ナノメートル未満の波長の光で使用するように最適化したポジ型レジスト

（二）　一ナノメートル超一五ナノメートル未満の波長の光で使用するように最適化したレジスト

ロ～ホ　［略］

二十・二十一　［略］

二十二　炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの半導体基板又はインゴット、ブール若しくはその他のプリフォームであって、二〇度の温度における電気抵抗率が一〇、〇〇〇オームセンチメートルを超えるもの

二十三　多結晶基板又は多結晶セラミック基板であって、二〇度の温度における電気の抵抗率が一〇、〇〇〇オームセンチメートルを超えるもののうち、当該基板の表面にシリコン、炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの非エピタキシャル単結晶層を少なくとも一層以上有するもの

リ　インプリントリソグラフィテンプレートであって、第一号から第八号の三までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの

ヌ　試験装置であって、半導体素子若しくは集積回路又はこれらの半製品用のもののうち、次のいずれかに該当するもの

（一）　三一・八ギガヘルツを超える周波数でトランジスタのエスパラメータを試験することができるように設計したもの

（二）　［略］

（三）　第二号ハに該当するマイクロ波用集積回路の試験を行うことができるように設計したもの

［新設］

十八　次のいずれかに該当するものの多層膜からなるヘテロエピタキシャル成長結晶を有する基板（ニに該当する化合物（窒化ガリウム、窒化インジウムガリウム、窒化アルミニウムガリウム、窒化インジウムアルミニウム、窒化インジウムアルミニウムガリウム、リン化ガリウム、砒化ガリウム、砒化アルミニウムガリウム、リン化インジウム、リン化インジウムガリウム、リン化アルミニウムインジウム又はリン化インジウムガリウムアルミニウムに限る。）のＰ型エピタキシャル層を一層以上有するものであって、当該Ｐ型エピタキシャル層がＮ型層に挟まれていないものを除く。）

イ～ニ　［略］

十九　レジストであって、次のいずれかに該当するもの又はそれを塗布した基板

イ　半導体用のリソグラフィに使用するレジストであって、次のいずれかに該当するもの

（一）　一五ナノメートル以上二四五ナノメートル未満の波長の光で使用することができるように設計したポジ型レジスト

（二）　一ナノメートル超一五ナノメートル未満の波長の光で使用することができるように設計したレジスト

ロ～ホ　［略］

二十・二十一　［略］

二十二　炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの半導体基板（炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの半導体基板であって、これらの物質のエピタキシャル層を少なくとも一層以上有するものを含む。）又はインゴット、ブール若しくはその他のプリフォームであって、二〇度の温度における電気抵抗率が一〇、〇〇〇オームセンチメートルを超えるもの

［新設］